

波長可変半導体レーザー (TDL) NH₃測定用



アンモニア測定で最高水準の性能を発揮

GPro 500は、アンモニアスリップ測定や煙道測定などの難易度の高いアプリケーションにおいて信頼性の高いNH₃分析を実現します。



低メンテナンス、低運用コスト

GPro 500は直接(in-situ)分析でき、メンテナンスが煩わしいコンディショニングシステムが不要なため、総所有コストを削減することができます。



設置が簡単

GPro 500は、アライメント調整不要のTDLガス分析計のため、TDLの設置やアライメント調整に関する負担は大幅に軽減されます。



難しい設置条件に対応可能なデザイン

GPro 500は、アンモニアガス分析計の測定システムに様々なプロセス適合オプションを組み合わせることで、配管径(50mm~1m超)などの幅広い設置条件に対応させることができます。



GPro 500 TDL分光計 NH₃モニタリング用

GPro™ 500アンモニア (NH₃) ガス分析計は、煙道測定におけるアンモニアの直接測定やアンモニアスリップアプリケーション向けに設計された独自の波長可変半導体レーザー (TDL) 分光計です。レーザー吸収分光法を採用し、低メンテナンスで正確な測定を実現しています。

このNH₃ガス分析計はアンモニアスリップアプリケーションのプロセス制御に非常に適しています。重要なアプリケーションにおいて高精度、高信頼性、高速の測定を実現するTDLガス分析計で、SIL 2に適合しています。

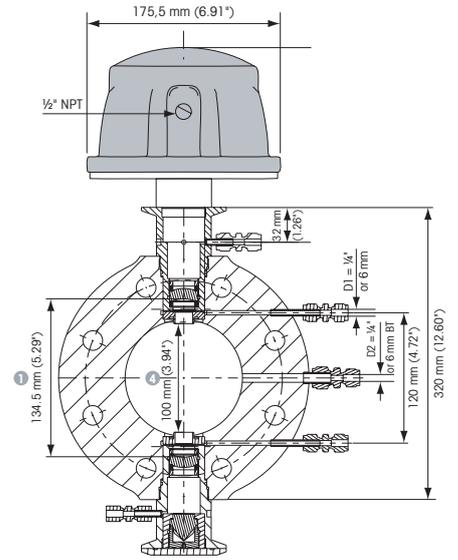
GPro 500 NH₃ガス分析計は、測定ポイントに直接(in-situ)設置するため、サンプルのコンディショニングを必要とせず、迅速な応答が得られます。メンテナンスが煩わしい抽出・コンディショニングシステムを必要とする技術に代わる、信頼性と費用対効果の高い選択肢となります。

GPro 500アンモニア分析計の技術仕様¹⁾:

測定対象ガス	アンモニア (NH ₃)
測定下限値	1ppm-v
測定範囲	0~1%
測定精度	測定値の2%または1ppm、いずれか大きい方
直線性	1%以内
分解能	1ppm-v
ドリフト	無視できる程度 (メンテナンス間隔の間に測定範囲の2%未満)
サンプリングレート	1秒
応答時間 (T90)	N ₂ 中のNH ₃ が1%~0%で4秒未満
繰返し性	測定値の±0.25%または5ppm-v (NH ₃)、 いずれか大きい方
プロセス圧力範囲	0.8~3bar (絶対圧力)
プロセス温度範囲	標準: 0~250°C 遮熱機能付き: 0~600°C PFAまたはPTFEフィルター付き: 0~150°C
有効光路長	50~800mm、適合オプションにより異なる

1) 標準的な条件下 (有効光路長1m、標準的な圧力 (P) と温度 (T)、埃や微粒子なし) における場合。

▶ www.mt.com/NH3-Analyzer



ウエハセル型GPro 500の設置例。



メトラー・トレド株式会社
プロセス機器事業部
お問い合わせ: www.mt.com/pro-MOs

仕様は予告なく変更する場合があります。
© 06/2022 METTLER TOLEDO
All rights reserved. PA2170ja A
MarCom Urdorf, CH

www.mt.com/pro

詳細はウェブサイトをご覧ください。